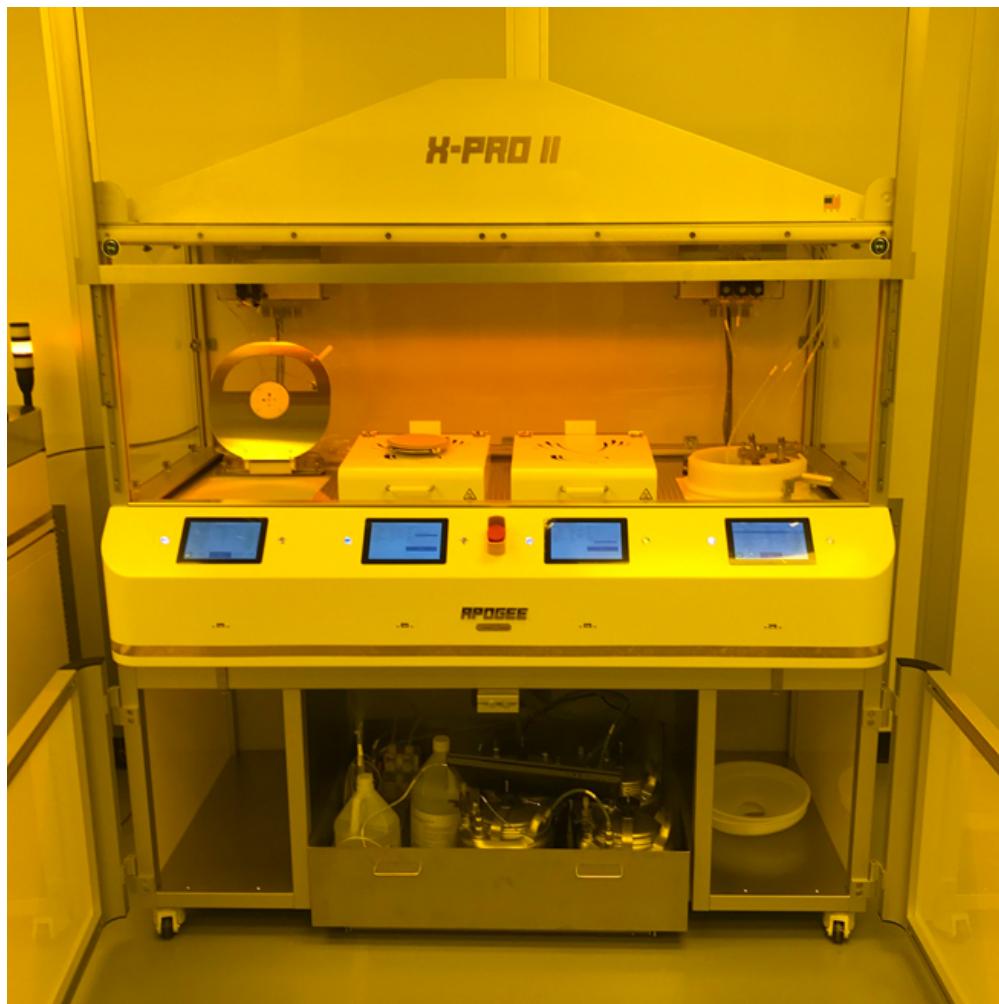


Установка проявления фоторезиста Apogee Developer

**Производитель:**

Cost Effective Equipment (CEE)

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка проявления фоторезиста Apogee Developer предназначена для одиночной обработки пластин размером до 200 мм (дополнительно 300 мм) или квадратных подложек с габаритами до 177×177 мм. В зависимости от конфигурации, проявление фоторезиста возможно выполнять двумя методами: спреем или струёй. Проявление фоторезиста спреем доступно с использованием до 4 сопел низкого или высокого давления, расположенных под углом или вертикально к подложке. При проявлении струей, подача проявителя осуществляется в центр подложки. Химически и коррозионностойкий материал рабочей чаши позволяет использовать все виды химических реагентов. Автоматическая система подачи проявителя в центрифугу, различные варианты

держателей подложек, опция отмычки лицевой и обратной стороны подложки в деионизованной воде, сушка лицевой поверхности азотом, делают центрифугу Apogee Developer универсальным решением для операций проявления фоторезиста и отмычки пластин. Управление центрифугой производится при помощи цветного сенсорного дисплея с GUI-интерфейсом. Инновационное программное обеспечение DataStream™ позволяет осуществлять работу по рецептам и анализировать рабочие параметры в режиме реального времени. Предусмотрены USB и Ethernet порты для экспорта/импорта данных. Конструкция установки проявления Apogee Developer выполнена по принципу «plug&play», тем самым обеспечивается простая инсталляция и легкое освоение для пользователей любого уровня.

Для заказа доступны как настольный вариант размещения, так и встраиваемый вариант для интеграции в рабочий модуль X-Pro II.

Область применения

- Проявление фоторезиста.
- Взрывная литография (lift-off).
- Отмыкация пластин в деионизированной воде.

Особенности

- Проявление фоторезиста спреем (до 4 сопел) или струей.
- Система автоматической подачи проявителя.
- Возможность отмычки лицевой и обратной стороны подложки в деионизированной воде.
- Сушка лицевой поверхности азотом.
- Быстрая смена подложкодержателя под пластины различного размера.
- Простой интерфейс управления с цветным сенсорным дисплеем 7" и инновационным ПО DataStream™.
- Лидирующий на рынке показатель надежности и времени безотказной работы.

Технические характеристики

Максимальный диаметр подложки	200 мм (дополнительно 300 мм) Фотошаблоны до 177×177 мм
Скорость вращения Разрешение Воспроизводимость	0 – 12.000 об/мин (регулируется в ПО)

Ускорение скорости вращения	0 – 30.000 (об/мин)/с (без подложки) 0 – 23.000 (об/мин)/с (с пластиной 200 мм)
Тип корпуса	Настольный или встраиваемый
Материал чаши	Химически и коррозионностойкий полиэтилен (HDPE)
Подача реагента	Автоматическая
Отмывка лицевой и обратной стороны	Имеется для пластин Ø50-200 мм
Сушка лицевой поверхности N2	Имеется для пластин Ø50-200 мм
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Цветной сенсорный LCD дисплей 7" • Встроенный контроллер с новейшим ПО DataStream™ для отображения параметров процесса в режиме реального времени • Интуитивно понятный GUI-интерфейс • Работа по рецептам (время шага 0-9999.9 с, разрешение 0.1 с) • USB/Ethernet порты для загрузки/выгрузки параметров рецепта • Экспорт данных в Excel • Встроенные защитные блокировки для безопасной работы
Габариты (Ш×В×Г)	336×483×457 мм
Вес	21 кг
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект универсальных держателей • Съемные вкладыши в чашу • Центрирующий инструмент для пластин • Сушка лицевой поверхности азотом • Емкость для сбора реагентов с сенсором уровня заполнения • Автоматический сливной разделитель для проявителя и ДИ воды